PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-122124

(43)Date of publication of application : 24.05.1991

(51)Int.CI.

CO8G 73/10 CO8G 73/06

(21)Application number: 02-221438

(71)Applicant: INTERNATL BUSINESS MACH

CORP (IBM)

(22)Date of filing:

24.08.1990

(72)Inventor: HEDRICK JR JAMES L

HOFER DONALD CLIFFORD

LABADIE JEFFREY W SWANSON SALLY A **VOLKSEN WILLI**

(30)Priority

Priority number : **89 413361**

Priority date: 27.09.1989

Priority country: US

(54) POLYIMIDE-POLY(PHENYLQUINOXALINE) BLOCK COPOLYMER

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject copolymer that is used for an insulator layer for a thin layer wiring structure adhesive and low in stress and swellability by reacting a monofunctional oligomer of a poly(phenylquinoxaline), a diamine, and tetracarboxylic acids followed by imidation. CONSTITUTION: A monofunctional oligomer of a poly (phenylquinoxaline) prepared from a phenylquinoxalineactivated fluorosubstitution product represented by the formula wherein Ph represents phenyl, bisphenate, and aminophenol is reacted with tetracarboxylic acids, such as pyromellitic dianhydride, and a diamine, such as phenylenediamine, in a solvent, such as N-methylpyrrolidone followed by imidation under heating thereby obtaining a block copolymer of a polyimide and a poly(phenylquinoxaline).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平3-122124 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

⑤Int. Cl. 5 73/10 C 08 G

識別記号

庁内整理番号

③公開 平成3年(1991)5月24日

73/06

NTF NTM 8830-4 J 8830-4 J

> 審査請求 有 請求項の数 4 (全5頁)

ポリイミドーポリ (フエニルキノキサリン) プロツクコポリマー ◎発明の名称

> 館 平2-221438 ②特

223出 願 平2(1990)8月24日

優先権主張

ジエイムズ・ラブト アメリカ合衆国カリフオルニア州(95054) サンタクラ

⑩発 明 者 ン・ヘドリツク・ジユ ラ、オークグロウブ450 - 108

ニア

@発 明 者 ドナルド・クリフオー

ド・ホウフアー

アメリカ合衆国カリフオルニア州 (95046) サンマルチ

ン、フットヒルアペニュー12235

インターナショナル・ 他出 願 人

ビジネス・マシーン ズ・コーポレーション アメリカ合衆国 10504. ニューョーク州アーモンク(番 地なし)

70復代理人 弁理士 髙木 千嘉

最終頁に続く

i. 発明の名称 ポリイミドーポリ (フェニルキ ノキサリン) プロックコポリ

2.特許請求の範囲

1) ポリイミド及びポリ(フェニルキノキサリ ン) のブロックコポリマー。

2) ポリイミド部分がピロメリト酸二酸無水物 及びオキシジアニリンからのものである、請 求項1記載のプロックコポリマー。

3) ポリイミド部分がピフェニル二酸無水物及 びフェニレンジアミンからのものである、請 求項1記載のブロックコポリマー。

4) プロックコポリマーが、ポリ(フェニルキ ノキサリン)の一官能のオリゴマーから生成 される、請求項し記載のブロックコポリマ

3.発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は、ポリイミドーポリ(フェニルキノ キサリン)プロックコポリマーに関する。この プロックコポリマーは、パッケージング材料と して、特にセラミックモジュール上の薄層配線 構造体における絶縁体層として有用である。

〔背景技術〕

薄層配線構造体のために現在使用されている パッケージング材料は、三つの主要な要件に合 致しない:

- (1) 接着性(ガラスセラミック及び、完全に硬 化したポリマーへの自己接着)
- (2) 低い応力 (低い熱膨張係数(TEC) または段 和メカニズム)及び
- (3) N-メチルピロリドン(NNP) と接触すると きの低い影問性。

多くのポリイミドについて観察される乏しい 接着性は、しばしば接着促進剤及び反応性イオ

ンエッチング(RIE) 表面処理によって固定されるが、この手法の信頼性は、温度及び温度は動において疑わしくそして関食に導く可能性がある。応力が低くそして影響しないフィルムが、加工の間のポリマーフィルムのクラッキング、層別離などを固避するために望まれている。ビフェニルニ酸無水物ーフェニレンジアミン(BPDA-PDA)は、これらの要件に合致する最終であるが、この材料の接着特性は致弱であるが、この材料の接着特性は致弱であるが、この材料の接着特性は受弱である。代わりに、ボリ(フェニルキノ サリン)(PPQ)は、広い範囲の基体に対して優れた接着特性を示すが、この材料は、N-メチルピロリドン(NMP)から加工することができずそして高いTECを有する。

PPOのような優れた接着及び低いNMP路両、ポリアミックエステルの加工特性、並びに硬化後、
剛性または半剛性ポリイミドの最終性質を示す

質を有する新しい種類の材料、ポリイミド-フ ェニルキノキサリンプロックコポリマーである。 本発明の鍵となる要素は、ポリアミドエステル 合成に適合する、NMP可溶性のアミン末端のPPQ オリゴマーを合成することができることである。 このPPGオリゴマーの合成は、ポリマー形成反 応としてビスフェネートとのキノキサリン=括 性化のフルオロ置換を用いて実施される。生成 するPPQは、NNP中への改良された溶解性をもた らす、ポリマー骨格中のアリーレンエーテル結 .合を有する。アミン官能基は、キャッピング剤 としてアミノフェノールを使用することによ って導入され、そして分子量は、カローザス (Carothers) の式を使用することによって制御 することができ、一及び二官能オリゴマーの両 方が可能である。本共重合の別の重要な特徴は、 最終コポリマーの単階及び精製を可能にするポ リアミックエステル化学の利用であり、この最

理想的な健康材料(コポリマー)を開発するといいます。ポリマェニルや、関ットに関ットに関ットに関ットに関ットに対対が、これが、からないの材料に、ポリリンのでは、ボリンのでは、ボリンのでは、ボリンのでは、ボリンのでは、ボリンのでは、ボリンのでは、ボリンのでは、ボットには、アースを受けるでは、できない。

ケミカルアブストラクツ10g:55338rは、 芳 香族水核置換によるポリフェニルキノキサリン の合成を示しているが、 それは、 本発明のプロックコポリマーとは関係しない。

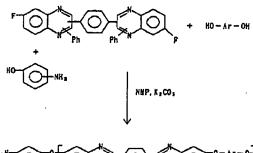
(発明の開示)

本発明は、審層多層構造体中の絶極 (dielectric)層として機能するのに必要な性

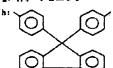
共コポリマーは、所望の処理密媒(または密媒混合物)中で再調製する(reformulated)とができる。このコポリマー合成は、NMP/CHP(N・シクロヘキシルピロリドン)中のPPQオリゴマー及びジアミンの密でした。この合成コゴマールスステルジアといるというでは、このでは、ココポリックの両方を製造するために使用された。異なびトリゴマーと共にオキシジアニリドを用いて数徴のジェチルエステルジアシルクロリドを用いて数徴のシリーズのコポリマーが合成された。

本発明への理解は、つぎのスキーム!および 2 を参照することによって容易になるである。





- a: -PhC(CH,),Ph-
- b: -PhC(Ph),Ph-
- f: 1.3-フェニレン g: 1.4-フェニレン
- c: -PhC(CF,).Ph-
- d: -Ph CO Ph-
- e: -PhSO:Ph-



スキーム」は、ポリ(フェニルキノキサリン)
PPQオリゴマーの合成を示す、構造式を用いた
図式的な略図である。この合成においては、ビスフェネートとのキノキサリン・活性化フルオロ畳換反応がポリマー形成反応である。

スキーム2は、コポリマー合成を示す、構造 式を用いた図式的な略図である。この合成は、 NMP/CRP中のPPQオリゴマー(スキーム1中で生 成された)及びジアミンの格液のジェステルジ アシルクロリドによる処理を含む。

本コポリマーの熱的及び機械的性質は優れていた。動的TGA及び400℃での等温TGAは、これらのコポリマーがポリイミドホモポリマーに匹敵する熱安定性を有することを示した。動的機
彼的分析は、PPQマイクロドメインと一致する、
250℃でのPPQブロックに対応するTgを示した。
これらの材料は、ポリイミドホモポリマーに類似した、450℃までの寸法安定性(弾性率の保持)

を示し、この材料の弾性率は、250で以上で約1桁(decade)だけ落ちた。このコポリマーは、2300MPa領域の弾性率及び約100%の伸びを有する強い延性の機械的性質を示した。加えて、このコポリマーのTECは、元のポリイミドのTECの約半分で15~22ppm(厚いフィルム)の範囲であった。

二つのポリマー層の接着を測定するために剝離テスト実験を実施した。この実験においては、第一層を特定の硬化温度(T」)に硬化させ、次に第二層を溶液強布しそしてT₂で硬化させた。
PNDA - ODAの自己接着は、各々の層のために使用された硬化温度に依存することが示された。
PNDA - ODAの対照サンブル(デュポンP1 - 2540ポリアミック酸)は、一般に乏しい自己接着を示し、特に第一層が完全に硬化する、即ちT₁ = 400℃であるときには、そうであった(第1 数)。同じ接着テストをポリイミド-PPQマルチブロ

ック及びトリブロックのでであるときに関してされなりでである名を表及いませんだった。 ここを着が観察されたいでは、アースの協会についるとのができるができるができるができるができるができるができる。 15% のPPQ組織が、のでは、アPQののPPQ組織が、のでは、アPQ

ボリイミド - PPOコポリマーは、NMP影調に対する優れた耐性を示した。マルチブロック及びトリブロックコポリマーの両方に関して得られたデータは、NMP/CHP混合物中の膨稠が2%未

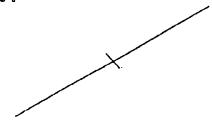
第	1	

	PMDA - ODA	PI 2540
<u>T,(°C)</u>	<u>T.(°C)</u>	剥離強さ(g/mm)
200	300	15
200	350	10
200	400	10
250	350	9
250	400	9
300	300	. 2
300	350	5
400	400	0.72

潰であることを示す。

要約すると、ブロックコポリマーの手法を揺るPPQのPNDA - ODA中への組み込みは、ポリイミドの望ましい性質を弱めることなく、TFM構造体のために要求される必要な接着及び低いNMP 脳潤を示す新しい混成ポリマーを与える。TEC はPNDA - ODAより低かった。

本発明のもっとも好ましい実施想様において、 は、最等の敬細構造を与えるために、PPQの一 官能オリゴマーを使用する。もっとも好ましい ポリイミドは、ピロメリト酸二酸無水物及びオ キシジアニリンからの並びにピフェニル二酸無 水物及びフェニレンジアミンからのポリイミド である。



ブロック長さ	Wt . 96 PPQ	<u>f.(°0)</u>	<u>T.(*0)</u>	<u>剝離強さ(g/mm)</u>
6.2 K	8	200	400	赞屠体
6-2 K	8	400	400	57
6.2 K	25	400	400	61
6.2 K	50	400	400	锁層体
15.5 K	13	200	400	贫層体
15.5 K	13	400	400	镁層体
15.5 K	25	400	400	積磨体
15.5 K	50	400	400	復層体
23 K	15	200	400	被陪体
23 K	15	400	400	镀層体

PI/PPU(O.U K) P 9 7 0 9 9			
WL. 96 PPQ	T.(°C)	<u>(°)</u>	剥離強さ(9/88)
25	200	400	積層体
25	400	400	積層体
50	200	400	锁層体
50	400	400	被層体

第 4 表

PI/PPQブロックコポリマープレンド

ブロック長さ	WL.96PPQ	<u>T.(°0)</u>	<u>T;(°0)</u>	別離強さ(9/88)
6.2 K	13	400	400	56
6.2 K	13プレンド R2	400	400	25
6.2 K	13プレンド R5	400	400	11
15-5 K	13	400	400	被層体
15.5 K	13ブレンド R=.2	400	400	被層体
15.5 K	13プレンド R=.5	400	400	

特許出題人 インターナショナル・ピジネス・ マシーンズ・コーポレーション

復代理人 弁理士 髙 木 千



第1頁の続き

⑫発	明	者	ジエフリー・ウイリア	アメリカ合衆国カリフオルニア州(95008)キヤンベル。
			ム・ラバディー	マクシミリアンドライブ2292
⑰発	明	者	サリー・アン・スウォ	アメリカ合衆国カリフオルニア州(95118)サンホゼー。
			ンソン	バランツリーウエイ1566
⑫発	明	耆	ヴイリ・フオルクゼン	アメリカ合衆国カリフオルニア州(95123)サンホゼー。
				エルポータルウエイ372